STM と DFT シミュレーションを用いた表面物性計測:

Si(100)表面におけるドーパント分子の吸着

極限計測ユニット 表面物性計測グループ 鷺坂 恵介

背景・目的

STM で検出されるトンネル電流は、STM 探針と表面の電子雲の重なりによって生じる。したがって、 STM は表面の波動関数の二乗すなわち電荷密度分布を画像化している。共有結合性の強い半導体などの 物質表面では電荷密度と原子核の位置が一致しない場合があり、STM で得られる画像が直接表面の原子 配列を反映していないことがある。そのため、STM 像の厳密な解釈には密度汎関数 (DFT) 法に基づく STM シミュレーションが有効である。実際に STM を用いた表面科学研究では、実験データと計算科学デー タの両方を取り扱った解析法が主流になりつつある。このような背景から、DFT 法 STM シミュレーショ ン技術を取り入れた表面計測法の確立を目指し、DFT 計算技術の習得を行うとともに、Si (100)表面に 吸着したリン原子および分子の構造および電子状態研究へと応用した¹⁾。

2. 研究成果

実験:清浄なSi(100)基板上にリン分子を吸着させた表面を試料とした。STM 観察は超高真空・低温 装置を用いて、試料温度78 K で行った。観察は全て電界イオン顕微鏡で前処理したタングステン探針 を用いて行った。

計算:DFT 計算は vasp コードを用いて行った。擬ポテンシャルには PAW 法、 交換相関ポテンシ ャルには GGA PBE を用いた。構造最適化を行った後、電荷密度データを用いて、STM 像のシミュレ ーションを行った。STM シミュレーションには bskan コードを用いた。



図 1 (a) リン分子吸着後の Si(100)表面の STM 像. (b) 5 種類の吸着 構造の拡大像. Vs = -1.5 V, T = 0.3 nA, T = 78 K.

図1にリン分子吸着後のSTM 像を示す。明るく画像化されている輝点がSi(100)表面に吸着したリン 分子に相当する。(暗い構造はSi(100)表面の清浄化プロセスで形成されたダイマー欠損欠陥である。) STM 像の特徴から吸着リン分子には5種類の構造が存在することが判明した。そこで様々な吸着モデ ルを構築し、STM シミュレーションを行った結果から、各吸着構造を決定した。その結果を図2に示 す。図2の上段は各吸着構造モデルを、下段はそれに対応するSTMの実験像と計算像を示す。5種類 の吸着構造のうち、4種類は二原子分子である二リンがSiダイマー列と同方向あるいは垂直方向のい ずれかの向きで、Siダイマー上あるいはSiダイマー列間に吸着していることがわかった。計算像では 実験像の特徴が良く再現されている。特に、正の試料バイアスで画像化された非占有状態像は吸着分 子の構造モデルから予測できず、シミュレーションを行わずに正確な構造決定ができない。一方、図2 の最右列の構造は四リンがSiダイマー列間に吸着したもので、興味深いことに四リンの唯一の吸着構 造である。半導体表面のSTMシミュレーションの場合、基本的にDFT計算ではスラブ寸法の制約な どから基板のドーピング状態を正しく取り扱うことができないので、フェルミ準位や基板と目的の構 造とのバンド位置がずれることがあるので注意が必要である。また、系によっては、フェルミ準位を 単純にずらすだけで、正しいSTM 像を再現することができることがある。

DFT 計算の結果から、5 種類の吸着構造の中で、二つの Si ダイマーに跨いで吸着した P2(I)構造が



図 2 上段: Si(100)表面におけるリン分子の 5 種類の吸着構造モデル.下段:それぞれの吸着構造 に対する STM の実験像とシミュレーション像との比較. 実験データはトンネル電流 0.3 nA, 温度 78 K で測定.

基底状態であることが判明した。そこで、 その他の4種類の構造に対して、通常の 画像化に用いる試料バイアスより大きな 電圧を印加することで基底状態に構造変 換が可能か確かめた(図3)。その結果、4 種類全ての吸着構造を基底状態に変換す ることができた。しかし、基底状態から 別の構造への変換には一度も成功してい ない。

以上に示したように、STM と DFT 計 算を組み合わせた表面物性計測法は、基 礎的な表面物性解析のための強力なツー ルとなる。

3. 展望

STM と DFT 計算の相性の良さから、両者 を用いた表面物性研究はますます盛んに なっていくと予想される。さらに、デー タ科学と組み合わせでマテリアルインフ オマティクス分野への進展も望まれる。



図 3 STM による Si(100)上のリン分子の構造変換. 各 STM 像の試料バイアスは図中に示してある通り. (a) および (c) I = 0.5 nA, (b) I = 0.3 nA, T = 78 K.

謝辞

DFT-STM シミュレーションを実施するにあたり、University College London の David Bowler 教授か ら多くの指導を頂いたので、感謝の意を表します。また、本研究の一部は科研費基盤 C(21760242)によ る助成を受けました。

参考文献

1) K. Sagisaka et al. Phys. Rev. B 87, 155316 (2013).